

日本真空協会 2011年2月研究例会
日本表面科学会 第67回表面科学研究会

主題 「In-situ モニタリングの視点からみた表面制御・評価技術 ～現状と課題～」

新機能材料・デバイスの作製工程は、真空をはじめとする制御された雰囲気下で行われるため、特殊な光や電子線などを駆使した表面計測技術と組み合わせることで精密な制御能力を備えることが出来る。しかしながら応用現場では、分解能などの本質的な問題は勿論、コスト的な問題などといった付随的な問題まで様々な制約から、このようなポテンシャルをもつ計測技術はその威力を十分発揮し得ていない。このような問題意識のもと、表面計測・制御技術の研究・開発の最前線におられる方々を講師としてお招きし、in-situ モニタリングの利用者の視点を交えて議論する機会として、研究会を開催致します。多数のご参加をお待ちしております。

日時：2011年2月2日(水)
13:00～16:45 (受付 12:30～)
場所：機械振興会館 地下3階B3-2号室
東京都港区芝公園3-5-8
電話 03-3431-4395 日本真空協会 (直通)
参加費：(当日会場にて御支払いください)
日本真空協会会員及び日本表面科学会会員 1,500円
非会員 2,500円 学生 無料
予稿集：1,000円

—講演プログラム—

- 開会の挨拶 (日本真空協会研究部会長) 杉山 直治 13:00～13:05
1. 「ナノ世代における半導体プロセス計測評価技術」
(独)産業技術総合研究所 金山 敏彦 13:05～13:45
2. 「光干渉法を用いたプラズマエッチング中の非接触基板温度・膜厚モニタリング」
(和歌山大学) 太田 貴之 13:45～14:25
3. 「表面反射分光による Si 表面反応過程のリアルタイム計測」
(横浜国立大学大学院工学研究院) 田中 正俊 14:25～15:05

—休憩—

4. 「III-V 太陽電池の高効率化に向けた有機金属気相成長プロセスの in situ 表面モニタリング」
(東京大学大学院工学系研究科総合研究機構) 杉山 正和 15:20～16:00
5. 「自己形成量子ドット成長過程のその場観察と新規光デバイスの作製」
(神戸大学大学院工学研究科) 喜多 隆 16:00～16:40
- 閉会の挨拶 (日本表面科学会企画委員長) 笹川 薫 16:40～16:45

問い合わせ先：日本真空協会 TEL：03-3431-4395 FAX：03-3433-5371
e-mail:ofc-vs@vacuum-jp.org
URL：http://www.vacuum-jp.org/

日本表面科学会 TEL：03-3812-0266 FAX：03-3812-2897
e-mail:shomu@sss-j.org

本件担当 日本真空協会研究部会 (東芝研究開発センター) 杉山 直治
(富士通研究所) 松倉 祐輔